



B. Patterning 분과

2021년 1월 27일(수), 16:30-18:00 / 채널 A

[WA5-B] Photolithography

좌장: 정연식 교수 (KAIST)

<p>WA5-B-1 16:30-17:00</p>	<p>[초청] Progress on EUVL Mask and Pellicle Research Jinho Ahn ¹Department of Materials Science and Engineering, Hanyang University, ²EUV-IUCC (Industry University Collaboration Center)</p>
<p>WA5-B-2 17:00-17:15</p>	<p>파티클로 인한 EUV 펠리클의 열-기계적 거동 변화의 실험적 검증 장용주^{1,4}, 위성주^{2,4}, 김하늘^{2,4}, 김창수^{3,4}, 안진호^{1,2,3,4} ¹한양대학교 나노반도체공학과, ²한양대학교 신소재공학과, ³한양대학교 나노융합과학과, ⁴한양대학교 EUV-IUCC</p>
<p>WA5-B-3 17:15-17:30</p>	<p>니켈을 활용한 고개구수 극자외선 노광공정용 고흡수도 마스크 연구 정동민^{1,3}, 한윤종^{2,3}, 김득규^{2,3}, 김연수^{1,3}, 안진호^{1,2,3} ¹한양대학교 신소재공학과, ²한양대학교 나노반도체공학과, ³한양대학교 EUV-IUCC</p>
<p>WA5-B-4 17:30-17:45</p>	<p>Cascade Domino Lithography for Single-Digit-Nanometer Scale Patterning Inki Kim¹ and Junsuk Rho^{1,2} ¹Department of Mechanical Engineering, POSTECH, ²Department of Chemical Engineering, POSTECH</p>
<p>WA5-B-5 17:45-18:00</p>	<p>Modeling of Stochastic Defects in the Extreme Ultra Violet Lithography Sang-Kong Kim The Faculty of Liberal Arts, Hongik University</p>

1
월
27
일
(수)